

## БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ОГРАНИЧЕННОГО ТУННЕЛЬНОГО КОНТАКТА ДВУХ КВАНТОВЫХ ЯМ

Грибников З. С.

Рассмотрена туннельная проводимость контакта двух квантовых ям на ограниченной полосе  $|x| < l$ . Предположено, что вне полосы либо барьер, разделяющий ямы, туннельно непроницаем (высок или широк), либо одна из ям отсутствует, т. е. ямы перекрываются внахлест.

Поскольку уровни квантования в ямах предполагаются близкими, вдоль системы туннельно-связанных ям распространяются две электронные волны с близкими, но различными волновыми векторами  $k_1$  и  $k_2$ , интерферирующие друг с другом в ограниченной структуре. Следствием этой интерференции являются размерные осцилляции проводимости туннельного контакта, а также баллистической проводимости ям, образующих этот контакт, с периодом осцилляций, определяемым разностным волновым вектором  $|k_1 - k_2| l = \pi$ . В случае двумерного электронного газа амплитуда осцилляций понижается за счет разброса поперечных волновых векторов  $k_y$ . Управление осцилляциями может быть выполнено с помощью эффекта поля, подстраивающего (или расстраивающего) туннельный резонанс ям.

Ввиду возможной малости  $|k_1 - k_2|$  период осцилляций имеет вполне макроскопический масштаб.

1. Первый объект данного рассмотрения, показанный на рис. 1, состоит из двух квантовых ям 1 и 2, перекрывающихся внахлест на полосе  $|x| < l$  и разделенных здесь туннельно-проницаемым потенциальным барьером. Таким образом, в этой полосе возникает туннельный контакт между ямами. Другим вариантом этой задачи является второй объект рассмотрения — туннельно-проницаемая полоса  $|x| < l$  в потенциальном барьере, разделяющем ямы 1 и 2 и непроницаемое вне полосы, т. е. при  $|x| > l$  (рис. 2).

Результатом предлагаемого далее расчета будет влияние как туннельного резонанса между электронными состояниями в ямах 1 и 2 на коэффициент прохождения электронов через контакт и на его электропроводность, так и квантового геометрического резонанса, возникающего при

$$2\delta kl = n\pi, \quad (1)$$

где  $n$  — целое число,  $2l$  — ширина полосы контакта,

$$2\delta k = k_1 - k_2, \quad (2)$$

$k_1$  и  $k_2$  — волновые векторы электронных волн в связанных квантовых ямах 1 и 2 вдоль оси  $x$  (рис. 1 и 2).

Вопрос о рациональной практической реализации контактов, подобных показанным на рис. 1 и 2, лежит вне пределов данной работы, хотя далее по ее ходу будут высказаны некоторые соображения.

2. Для максимальной простоты будем пренебрегать различием эффективных масс электронов в квантовых ямах и барьерах, сведя их к одной:  $m$ . Остановимся сначала на варианте, показанном на рис. 1.

Рассмотрим квантовое состояние с энергией  $E$ , имеющее вид свободной электронной волны с волновым вектором  $k_y$  вдоль оси  $y$ , нормальной к плоскости чертежа; в плоскости же  $(x, z)$  это состояние имеет вид падающей волны с волновым вектором  $k'$  при  $x < -l$ , отраженной волны с волновым вектором  $-k'$  там же и проходящей волны с волновым вектором  $k''$  при  $x > l$ . В направлении

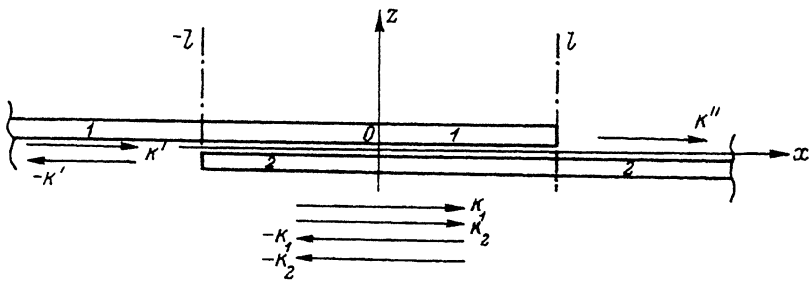


Рис. 1. Туннельный контакт внахлест для двух квантовых ям.

оси  $z$  рассматриваемое состояние захвачено в яме 1 при  $x < -l$ , в яме 2 при  $x > l$  и в обеих ямах при  $x < |l|$ . Запишем это состояние. При  $x < -l$  имеем

$$\psi(x, z) = \psi_1(z) (e^{ik'x} + Be^{-ik'x}), \quad (3)$$

где

$$\varepsilon \equiv E - \frac{\hbar^2 k_y^2}{2m} = \frac{\hbar^2 (k')^2}{2m} + \varepsilon_1^{(0)}, \quad (3')$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi_1}{dz^2} + U_1(z) \psi_1 = \varepsilon_1^{(0)} \psi_1, \quad (4)$$

$U_1(z)$  — «одноямный» потенциал для ямы 1 при  $x < -l$ . При  $x > l$  имеем

$$\psi(x, z) = C\psi_2(z) e^{ik''x}, \quad (5)$$

где

$$\varepsilon = \frac{\hbar^2 (k'')^2}{2m} + \varepsilon_2^{(0)}, \quad (5')$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi_2}{dz^2} + U_2(z) \psi_2 = \varepsilon_2^{(0)} \psi_2, \quad (6)$$

а  $U_2(z)$  — одноямный потенциал для ямы 2 при  $x > l$ . При  $|x| < l$  ищем решение в виде

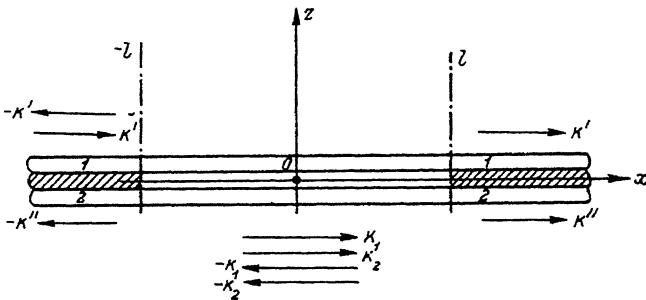


Рис. 2. Туннельный контакт между квантовыми ямами в полосе  $|x| < l$ .

Заштрихованные части барьера непроницаемы для электронов.

$$\psi(x, z) \approx \psi_1(z) (A_1 e^{ik_1 x} + B_1 e^{-ik_1 x} + A_2 e^{ik_2 x} + B_2 e^{-ik_2 x}) + \psi_2(z) [\xi_1 (A_1 e^{ik_1 x} + B_1 e^{-ik_1 x}) + \xi_2 (A_2 e^{ik_2 x} + B_2 e^{-ik_2 x})], \quad (7)$$

где

$$\varepsilon = \frac{\hbar^2 k_1^2}{2m} + \varepsilon_1 = \frac{\hbar^2 k_2^2}{2m} + \varepsilon_2, \quad (7')$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi^{(1,2)}}{dz^2} + U(z) \psi^{(1,2)} = \varepsilon_{1,2} \psi^{(1,2)}, \quad (8)$$

$U(z)$  — двухъямный потенциал при  $|x| < l$ :  $U(z) = U_1(z) + \delta U_1(z) = U_2(z) + \delta U_2(z)$ . Решение (7) является линейной комбинацией падающих и отраженных волн:

$$\psi(x, z) = (A_1 e^{ik_1 x} + B_1 e^{-ik_1 x}) + \psi^{(1)}(z) + (A_2 e^{ik_2 x} + B_2 e^{-ik_2 x}) \psi^{(2)}(z), \quad (9)$$

причем

$$\psi^{(1,2)}(z) \approx \psi_1(z) + \xi_{1,2} \psi_2(z). \quad (9')$$

Отметим, что исходные состояния  $\psi_{1,2}(z)$ , принадлежащие различным одноямным потенциалам  $U_{1,2}(z)$ , не ортогональны друг другу:

$$\varphi_{12} = \int dz \psi_1^*(z) \psi_2(z) \neq 0. \quad (10)$$

Поскольку далее рассматриваются только случаи, когда энергии состояний  $\varepsilon_1^{(0)}$  и  $\varepsilon_2^{(0)}$ , а также  $\varepsilon_1$  и  $\varepsilon_2$  близки друг другу и гораздо сильнее отделены от энергий всех прочих состояний,  $\varepsilon_{1,2}$  через  $\varepsilon_{1,2}^{(0)}$  могут быть получены с помощью теории возмущений для почти вырожденных состояний:

$$\varepsilon_{1,2} = \frac{\tilde{\varepsilon}_1 + \tilde{\varepsilon}_2}{2} \mp \frac{1}{2} [(\tilde{\varepsilon}_1 - \tilde{\varepsilon}_2)^2 + 4\tilde{u}_{12}\tilde{u}_{21}]^{1/2}, \quad (11)$$

где

$$\tilde{\varepsilon}_1 = \varepsilon_1^{(0)} + \frac{u_{11} - \varphi_{12}u_{21}}{1 - |\varphi_{12}|^2}; \quad \tilde{\varepsilon}_2 = \varepsilon_2^{(0)} + \frac{u_{22} - \varphi_{21}u_{12}}{1 - |\varphi_{12}|^2};$$

$$\tilde{u}_{12} = \frac{u_{12} - \varphi_{12}u_{22}}{1 - |\varphi_{12}|^2}; \quad \tilde{u}_{21} = \frac{u_{21} - \varphi_{21}u_{11}}{1 - |\varphi_{12}|^2}; \quad \varphi_{21} = \varphi_{12}^*;$$

$$u_{11} = \int dz \psi_1^* \delta U_1 \psi_1; \quad u_{12} = \int dz \psi_1^* \delta U_2 \psi_2;$$

$$u_{22} = \int dz \psi_2^* \delta U_2 \psi_2; \quad u_{21} = \int dz \psi_2^* \delta U_1 \psi_1. \quad (11')$$

Фигурирующие в (7) коэффициенты  $\xi_{1,2}$  даются формулами

$$\xi_{1,2} = -\frac{\varepsilon_{1,2} - \tilde{\varepsilon}_1 - \varphi_{12}\tilde{u}_{21}}{(\varepsilon_{1,2} - \tilde{\varepsilon}_2) \varphi_{12} - \tilde{u}_{12}} = -\frac{(\varepsilon_{1,2} - \tilde{\varepsilon}_1) \varphi_{21} - \tilde{u}_{21}}{\varepsilon_{1,2} - \tilde{\varepsilon}_2 - \varphi_{21} - \tilde{u}_{12}}, \quad (12)$$

из которых следует

$$\xi_{1,2} = -\frac{1}{2\tilde{u}_{12}} (\tilde{\varepsilon}_1 - \tilde{\varepsilon}_2 \pm \sqrt{(\tilde{\varepsilon}_1 - \tilde{\varepsilon}_2)^2 + 4\tilde{u}_{12}\tilde{u}_{21}}), \quad (12')$$

т. е.  $\xi_1 \xi_2 = -\tilde{u}_{21}/\tilde{u}_{12}$ ,

$$\xi_1 + \xi_2 = -\frac{\tilde{\varepsilon}_1 - \tilde{\varepsilon}_2}{\tilde{u}_{12}}, \quad \xi_1 - \xi_2 = -\frac{\sqrt{(\tilde{\varepsilon}_1 - \tilde{\varepsilon}_2)^2 + 4\tilde{u}_{12}\tilde{u}_{21}}}{\tilde{u}_{12}}. \quad (13)$$

Из определения (11') интегралов  $u_{12}$  и  $u_{21}$  и с учетом

$$U(z) = U_1(z) + \delta U_1(z) = U_2(z) + \delta U_2(z)$$

следует

$$u_{12} = u_{21}^* + (\varepsilon_1^{(0)} - \varepsilon_2^{(0)}) \varphi_{12}.$$

Для вещественных волновых функций  $\psi_{1,2}(z)$  отсюда имеем

$$\tilde{u}_{12} - \tilde{u}_{21} = (\tilde{\varepsilon}_1 - \tilde{\varepsilon}_2) \varphi_{12}. \quad (14)$$

Поскольку  $\int dz [\psi_1(z) + \xi_1 \psi_2(z)] [\psi_1(z) + \xi_2 \psi_2(z)] = 1 + \xi_1 \xi_2 + \varphi_{12} (\xi_1 + \xi_2)$ , из (13) и (14) следует строгая ортогональность гибридных состояний с энергиями  $\varepsilon_1$  и  $\varepsilon_2$ .

3. Для геометрии на рис. 1 используем следующие граничные условия, определяющие константы  $B$ ,  $C$ ,  $A_{1,2}$  и  $B_{1,2}$ , введенные выше.

1) Условия обрыва слоев в точках  $x = \pm l$ :

$$A_1 e^{ik_1 l} + B_1 e^{-ik_1 l} + A_2 e^{ik_2 l} + B_2 e^{-ik_2 l} = 0, \quad (15)$$

$$\xi_1 (A_1 e^{-ik_1 l} + B_1 e^{ik_1 l}) + \xi_2 (A_2 e^{-ik_2 l} + B_2 e^{ik_2 l}) = 0. \quad (16)$$

2) Условия непрерывности функций и их производных на этих же границах полосы туннельного контакта, из которых следует:

$$k'' = \frac{k_1 \xi_1 (A_1 e^{ik_1 l} - B_1 e^{-ik_1 l}) + k_2 \xi_2 (A_2 e^{ik_2 l} - B_2 e^{-ik_2 l})}{\xi_1 (A_1 e^{ik_1 l} + B_1 e^{-ik_1 l}) + \xi_2 (A_2 e^{ik_2 l} + B_2 e^{-ik_2 l})}, \quad (17)$$

$$-k' = \frac{k_1 (A_1 e^{-ik_1 l} - B_1 e^{ik_1 l}) + k_2 (A_2 e^{-ik_2 l} - B_2 e^{ik_2 l}) - k' e^{-ik' l}}{A_1 e^{-ik_1 l} + B_1 e^{ik_1 l} + A_2 e^{-ik_2 l} + B_2 e^{ik_2 l} - e^{-ik' l}}. \quad (18)$$

Уравнения (15)–(18) позволяют найти  $A_{1,2}$  и  $B_{1,2}$ ; с их помощью далее определяются коэффициент пропускания  $T = \frac{k''}{k'} |C|^2$  и коэффициент отражения  $|B|^2$ .

Для  $T$  имеем

$$T = \frac{64k'k''}{|D|^2} \xi_1^2 \xi_2^2 (\xi_1 - \xi_2)^2 (k_2 \sin 2k_1 l - k_1 \sin 2k_2 l)^2, \quad (19)$$

где  $D$  — детерминант системы линейных уравнений (15)–(18); согласно (3'), (5'), (7'),

$$k_{1,2}^2 = \frac{2m}{\hbar^2} (\varepsilon - \varepsilon_{1,2}), \quad k''^2 = \frac{2m}{\hbar^2} (\varepsilon - \varepsilon_{1,2}^{(0)}).$$

Рассмотрим случай достаточной близости к туннельному резонансу и достаточно большой кинетической энергии электрона, а именно предположим, что энергия Ферми  $\mu$  в вырожденном случае (или температура электронов в невырожденном случае) существенно превышает разницу

$$2\delta\varepsilon = \varepsilon_2 - \varepsilon_1 > 0.$$

Тогда векторы  $k_{1,2}$  и  $k''$  все близки друг другу:  $\delta k, |\delta k''| \ll k$ , где

$$k_{1,2} = k \pm \delta k, \quad k = (k_1 + k_2)/2, \quad \delta k = (k_1 - k_2)/2 - \frac{\sqrt{m}}{2\hbar^2} \delta\varepsilon/\sqrt{\varepsilon - \bar{\varepsilon}},$$

$$k','' = k + \delta k','', \quad \bar{\varepsilon} = (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)/2.$$

При этом

$$|D|^2 \approx 16K^4 (\xi_1 - \xi_2)^4 F, \quad (20)$$

где  $F = 1 - 4\Delta \cos 4kl (1 - \cos 4\delta kl) + 4\Delta^2 (1 - \cos 4\delta kl)^2$ ,  $\Delta = \xi_1 \xi_2 / (\xi_1 - \xi_2)^2$ ,

а для коэффициента пропускания имеем

$$T(k) = \frac{4\xi_1^2 \xi_2^2}{(\xi_1 - \xi_2)^2} \frac{4\cos^2 2kl \sin^2 2\delta kl}{F}. \quad (21)$$

Первый сомножитель в правой части (21) описывает резонансный характер пропускания: он максимален при  $\tilde{\varepsilon}_1 = \tilde{\varepsilon}_2$ , достигает при этом  $\tilde{u}^{21}/\tilde{u}_{12} \approx 1$  и спадает по мере удаления  $\tilde{\varepsilon}_1$  и  $\tilde{\varepsilon}_2$  друг от друга. Ширина полосы резонанса имеет порядок  $4(\tilde{u}_{12}\tilde{u}_{21})^{1/2}$ . Из (21) также видно, что в зависимости от ширины контактной полосы  $2l$  коэффициент  $T$  осциллирует. Имеются два пространственных периода осцилляций:  $l_1 = \pi/2k$  и  $l_2 = \pi/2\delta k$ . При  $m = 0.5 \cdot 10^{-28}$  г и  $\varepsilon - \bar{\varepsilon} = 0.05$  эВ [здесь и далее  $\bar{\varepsilon}_1 = (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)/2$ ] имеем  $l_1 \approx 0.5 \cdot 10^{-6}$  см, т. е. 50 Å. Если  $\tilde{u}_{12} = \tilde{u}_{21} = 0.001$  эВ, то  $l_2 \approx 2l_1 \frac{\varepsilon - \bar{\varepsilon}}{\delta\varepsilon} = 100$ ,  $l_1 = 0.5$  мкм, т. е. в отличие от периода  $l_1$  период  $l_2$  может иметь вполне макроскопический масштаб.

Если контактная полоса достаточно узка по сравнению с периодом  $l_2$ :

$$2\delta kl \ll \pi$$

или

$$l \left( \frac{m}{2\hbar^2} \frac{(\tilde{\varepsilon}_1 - \tilde{\varepsilon}_2)^2 + 4\tilde{u}_{12}\tilde{u}_{21}}{\varepsilon - \bar{\varepsilon}} \right)^{1/2} \ll \pi,$$

то

$$T(k) \approx \frac{8\tilde{u}_{21}^2 l^2 m}{\hbar^2 (\varepsilon - \bar{\varepsilon})} \cos^2 2kl, \quad (22)$$

т. е. собственно резонансные свойства туннельного контакта никак не выявляются. Для их проявления туннельный контакт должен быть достаточно протяженным.

4. Наличие осцилляций коэффициента пропускания с большим периодом  $l_2$  проявляется в линейной электропроводности туннельного контакта, изображенного на рис. 1. Рассмотрим ее для случая вырожденного электронного газа. В этом случае электропроводность определяется усредненным коэффициентом пропускания на энергетической поверхности Ферми  $E = E_F$ . С учетом (21) она при  $\Delta \ll 1$  дается формулой

$$\sigma = \sigma_0 T_0 \int_0^{\pi/2} d\varphi \cos \varphi \cos^2 (\lambda \cos \varphi) \sin^2 (\lambda' / \cos \varphi), \quad (23)$$

Рис. 3. Зависимость интеграла  $J = \int_0^{\pi/2} d\varphi \cos \varphi \sin^2$   
 $(\lambda' / \cos \varphi)$  от параметра  $\lambda'$ .

На вставке — начальный фрагмент этой же зависимости.

где

$$\sigma_0 = \frac{e^2 m}{\pi^2 \hbar^2} \sqrt{\frac{2(E_F - \bar{\epsilon})}{m}}$$

— баллистическая проводимость двумерного проводника, обусловленная стеночным током в интервале  $(E_F, E_F - eV)$ , где  $V$  — приложенное напряжение,

$$T_0 = 4\tilde{u}_{21}^2 / [\tilde{u}_{12}\tilde{u}_{21} + (\bar{\epsilon}_1 - \bar{\epsilon}_2)^2 / 4], \quad \lambda = 2k_0 l,$$

$$\lambda' = \lambda \delta \epsilon / 2 (E_F - \bar{\epsilon}); \quad k_0^2 = \frac{2m}{\hbar^2} (E_F - \bar{\epsilon}).$$

При  $\lambda \gg 1$ , что, по-видимому, всегда реалистично,  $\cos^2(\lambda \cos \varphi)$  под интегралом в (23) может быть заменен на  $1/2$ .

Рассмотрим сначала электропроводность настолько узкой контактной полосы, что

$$\lambda' \ll 1. \quad (24)$$

В этом случае главный вклад в электропроводность дают электроны с  $\cos \varphi \approx \approx 0$ , т. е. движущиеся почти поперек направлению тока. Приближенное вычисление интеграла из (23) для этого случая приводит к формуле

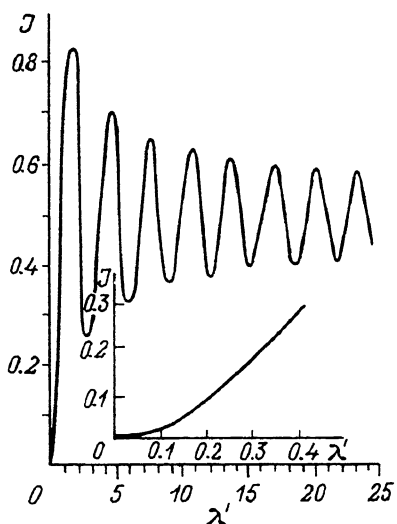
$$\sigma \approx 4 \frac{e^2 m^2}{\pi^2 \hbar^4} \sqrt{\frac{2}{m(E_F - \bar{\epsilon})}} \tilde{u}_{21}^2 l^2 \left[ -\ln \left( \frac{k_0 l \delta \epsilon}{2(E_F - \bar{\epsilon})} \right) + \frac{3}{2} \right]. \quad (25)$$

Здесь видны следующие особенности: отсутствие резонансной зависимости от  $\delta \epsilon$  (исключая слабую логарифмическую зависимость); квадратичная (а не линейная) зависимость проводимости от ширины контактной полосы; падение электропроводности с ростом энергии Ферми. Логарифмический множитель в (25), несколько повышающий средний коэффициент пропускания, связан с упомянутым выше вкладом поперечных электронов.

На рис. 3 представлен результат численного интегрирования — удвоенный интеграл из правой части (23), в котором  $\cos^2(\lambda \cos \varphi)$  заменен на  $1/2$ , в функции безразмерной ширины контактной полосы:  $\lambda' = \lambda \delta \epsilon / 2 (E_F - \bar{\epsilon}) = l/l_0$ , где

$$l_0 = \hbar \sqrt{2m^{-1} (E_F - (\bar{\epsilon}_1 + \bar{\epsilon}_2)/2) / [(\bar{\epsilon}_1 - \bar{\epsilon}_2)^2 + 4\tilde{u}_{12}\tilde{u}_{21}]}. \quad (26)$$

Из рис. 3 видно, что, хотя глубина осцилляционной модуляции утерялась, сама осциллирующая зависимость сохраняется при весьма больших значениях  $\lambda'$ . Естественно, весьма большие значения  $\lambda'$  проблематичны вследствие требования баллистического пролета электронов. Диссипативный же характер движения электронов быстро зомет предсказанные осцилляции. На вставке к рис. 3



показан начальный участок графика  $J = J(\lambda')$  для малых  $\lambda'$ , из которого видно, что квазиквадратичный ход  $\delta$  от  $l$  [см. формулу (25)] сохраняется при  $\lambda' \leq 0.2$ .

Естественно, более благодарным объектом наблюдения пространственно-осцилляционных зависимостей рассматриваемого здесь типа был бы туннельный контакт не двумерных квантовых ям — слоев, а одномерных ям — нитей (контактирующих туннельно на участке длиной  $2l$ ). В этом случае зависимость типа (21) могла бы проявиться в чистом виде при условии заполнения электронами только нижайших подзон.

В реальном эксперименте осцилляционные зависимости  $\sigma = \sigma(\lambda')$  следует искать, разумеется, изменяя в  $\lambda' = l/l_0$  не реальную ширину контакта  $2l$ , а нормировочный знаменатель  $l_0$ , т. е. изменяя  $\bar{\epsilon}_1 - \bar{\epsilon}_2$  в окрестностях резонансной точки. Это изменение может быть выполнено с помощью эффекта поля. Варианты такого эффекта поля диссипативной проводимости двухъямных объектов рассмотрены теоретически в [1, 2]; экспериментальная реализация продемонстрирована в [3].

5. В варианте структуры, показанной на рис. 2, предполагаются, как сказано выше, существование туннельной проницаемости барьера, разделяющего квантовые ямы, в полосе  $|x| < l$  и ее отсутствие всюду вне полосы; однако сами ямы существуют при всех значениях  $x$ . Падающая слева волна с волновым вектором вдоль оси  $x$ , равным  $k'$ , в верхней яме 1 вызывает отраженную волну с волновым вектором  $-k'$  в этой яме, а также отраженную волну с вектором  $-k''$  в нижней яме 2. Направо в этих ямах пройдут волны с векторами  $k'$  и  $k''$ , существующие при  $x > l$ . На контактной полосе  $|x| < l$  возникнут связанные двухъямные волны с волновыми векторами  $k_1, k_2, -k_1, -k_2$ , даваемые формулой (7). Используя на всех четырех контактах  $x = \pm l$  граничные условия типа (17) или (18), можно вычислить два коэффициента прохождения  $T' = |C'|^2$  и  $T'' = \frac{k''}{k'} |C''|^2$  и два коэффициента отражения  $R' = |B'|^2$  и  $R'' = \frac{k''}{k'} |B''|^2$ ; здесь  $C', C''$  и  $B', B''$  — амплитуды проходящих и отраженных волн в слоях 1, 2 соответственно. Не выписывая точных выражений, ограничимся лишь теми приближенными вариантами формул, в которых пренебрегается различием  $k', k'', k_1$  и  $k_2$  всюду, кроме аргументов тригонометрических функций. В этом случае  $R' \approx 0$ ,  $R'' \approx 0$ ,

$$T'' = \frac{4\tilde{u}^2}{4\tilde{u}^2 + (\bar{\epsilon}_1 - \bar{\epsilon}_2)^2} \frac{1 - \cos 4\delta kl}{2}, \quad (26)$$

$$T' = 1 - T'', \quad (26')$$

где  $\tilde{u} = \tilde{u}_{12} \approx \tilde{u}_{21}$ . Из формул (26) и (26') видно, что волна, проходящая по верхней яме 1, дает в полосе туннельного контакта ответвление в яму 2, причем в точке туннельного резонанса  $\bar{\epsilon}_1 = \bar{\epsilon}_2$  в зависимости от величины  $4\delta kl$  возможны различные варианты. При  $4\delta kl = 0, 2\pi, \dots, 2n\pi, \dots$  электронная волна проходит по слою 1, не ответвляясь вовсе в слой 2; при  $4\delta kl = \pi, 3\pi, \dots, (2n+1)\pi, \dots$  эта волна целиком переходит в слой 2, не оставаясь в слое 1; при  $4\delta kl = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \dots, \frac{2n+1}{2}\pi, \dots$  волна делится строго пополам между слоями.

Опыты со строгим и полным делением электронной волны можно осуществить лишь в случае одномерных туннельно-связанных проводников. Однако, как следует из рис. 3, и в случае двумерных квантовых ям — слоев электропроводность верхнего слоя  $\sigma_{11}$  и «проходная» электропроводность  $\sigma_{12}$  также могут существенно осциллировать в зависимости от длины  $\lambda' = l/l_0$ , т. е. управляться с помощью эффекта поля:

$$\sigma_{12} = \sigma_0 T_0 J(\lambda'), \quad \sigma_{11} = \sigma_0 (1 - T_0 J(\lambda')). \quad (27)$$

Отметим, что в данном примере в отличие от первого отсутствуют осцилляции с малым периодом  $l_1$ . Это связано с тем, что в приближении равных волновых векторов  $k' \simeq k'' \simeq k_1 \simeq k_2$  отсутствует внутрислойное отражение, т. е. отражение в пределах каждого из слоев 1 или 2, которые нигде не прерываются (в отличие от ситуации в первом варианте на рис. 1). Имеет место только межслойное отражение, связанное с неоднородными свойствами потенциального барьера между квантовыми ямами. Межслойное отражение проявляет только межслойный волновой вектор.

В экспериментальных структурах, в которых общий размер в направлении оси  $x$  существенно превышает ширину контактной полосы  $2l$ , проводимость может не сохранить баллистический характер и стать диссипативной. Разумеется, учет диссипативного характера проводимости образца может сильно исказить количественно формулы типа (27). Эти формулы заработают при тех значениях  $\bar{\epsilon}_1 - \bar{\epsilon}_2$  и  $2l$ , при которых проводимости  $\sigma_{12}$  и  $\sigma_{11}$  станут меньше диссипативных проводимостей длинных «омических» контактов к собственно туннельному контакту.

Для реализации необходимых здесь структур наряду с прямыми возможностями микротехнологии нужно использовать систему затворов, управляемых точно выбранным сочетанием потенциалов.

В заключение отметим явное родство описанных здесь электронных процессов с оптическими явлениями в оптоволоновых ответвителях [4]. В частности, устройство, показанное на рис. 2, является аналогом пары связанных диэлектрических волноводов, рассмотренных в гл. 7 [4].

Автор благодарен Н. З. Вагидову за дружескую помощь.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Vinter B., Tardella A. // Appl. Phys. Lett. 1987. V. 50. N 7. P. 410—412.
- [2] Борблик В. Л., Грибников З. С., Маркевич Ю. П. // ФТП. 1991. Т. 25. В. 8. С. 1302—1314.
- [3] Palevski A., Belfram F., Capasso F., Pfeiffer L., West K. W. // Phys. Rev. Lett. 1990. V. 65. N 15. P. 1929—1932.
- [4] Хаус Х. Волны и поля в оптоэлектронике. М., 1988.

Институт полупроводников АН Украины  
Киев

Получена 12.11.1991  
Принята к печати 26.11.1992